

새로운 표면 단분자막의 제작법과 이의 분석

박정진, 이수형, 김우식¹, 장상목, 이상록, 김종민*
동아대학교 화학공학과; ¹경희대학교 화학공학과
(jmkim3@daunet.donga.ac.kr*)

나노기술에 있어서 박막제조 기술은 전지, 전자 재료로서의 응용뿐만 아니라 재료의 특성기술 분석 기술로서 이용 될 수 있다. 나노 박막의 제조 방법으로는 SAM(Self assembled monolayer) 와 LB (Langmuir-blodgett) 그리고 CVD(Chemical vapor deposition) 법이 가장 대표적인 방법이다. 그러나 이들 방법은 특정한 작용기(SAM)가 필요하거나, 양친매성 재료를 요구하고(LB법) 되어지고 CVD의 경우에는 화학적인 활성이 필요하게 되어 단분자 막의 응용이 제한을 받고 있다. 이를 극복하기 위하여 본 연구그룹에서는 다양한 물질에 적용될 수 있는 새로운 박막의 제작법을 고안 하여 이 박막의 생성과정을 분석하였다.